

CF-M25 Ellipsometer 橢圓儀 M2000

注意事項

自行操作

Thin film measurement for n&k /Thickness :

- 1.SiO₂
- 2.Si₃N₄
- 3.Si
- 4.PR
- 5.消光系數 k=0 之 穿透薄膜
- 6.TEOS Oxide Film
- 7.HfO_x/Ta₂O₅/Al₂O₃... 等 High-K material

- 一、手動量測，Substrate 為 Si wafer 等基板需小於 1mm，Z stage 高度請設定基板厚度並防止 probe 撞壞。
 - 二、因人為使用不當，造成機台手臂與 STAGE 相撞，須照原廠維修費報價賠償，還需停權處置。
 - 三、禁止任何特殊製程需要變動機台硬體設備，如變動 Probe 改變 SCAN ANGLE 等。
 - 四、每周三/四上午九點三十至十二點為使用資格考核時間及機台校正時段，請使用者配合以避免衝突與等候。
 - 五、請勿刪除或存檔覆蓋 Model 內的 database。
 - 六、再次叮嚀，使用完一定要詳細填寫紀錄簿，謝謝大家的合作。
 - 七、使用過程中遇到任何 error message，或有任何疑問歡迎洽詢負責工程師 劉瑞敏（分機：7716）或是 E-mail 來信(jmliu@narlabs.org.tw)。
- 謝謝!!

CF-M25 Eillipsometer 橢圓儀 M2000

注意事項

委託代工規則說明

